



低压、气动旋转衬底座XG2-1型MOCVD装置

文献类型: 成果

作者 高鸿楷; 何益民; 徐瞬; 郭银其; 赛小锋

获奖日期 2004

文献子类 省部自然科学奖

奖励等级 省级三等奖

关键词 Mocvd 气动旋转衬底座

学科主题 半导体材料

英文摘要 MOCVD装置是当今国际上, 用于生长半导体单晶薄膜的先进设备。它广泛应用于制备航天太阳能电池, 半导体激光器, 光电阴极, 发光管, 微电子器件和各种量子阱结构材料。该装置利用了自己的专利技术制作成低压、气动旋转衬底座反应室, 使得该装置拥有自主知识产权。该装置填补了国内卧式MOCVD反应室衬底旋转技术的空白, 总体水平达到了国际上90年代同类产品的先进水平。为我国MOCVD技术发展, 特别是MOCVD装置的制造技术做出了重要贡献。

资助项目 瞬态光学技术国家重点实验室

语种 中文

源URL [http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/18649]

专题 西安光学精密机械研究所_中国科学院西安光学精密机械研究所(2010年前)

推荐引用方式 高鸿楷,何益民,徐瞬,等. 低压、气动旋转衬底座XG2-1型MOCVD装置. . 2004.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [西安光学精密机械研究所](#)

浏览	下载	收藏
10	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。